NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心

文件名稱:設備作業標準(SE-011射頻濺鍍機)文件編號:Q3-NL04制訂部門:異質整合製程組制訂日期:2019-02-15

文件制修訂記錄

版本	編製者	生效日期	核定文號	改版/變更說明	修訂頁次
1.0	蔡來福	2019-02-22	IS108008	制定新版	

NARLab	s 國家實驗研究院	DOCUMENT NO. :	TITLE :				
台灣主	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	Q3-NL04		設備作業標準			
	「寺腔町バール			(SE-011	射頻濺鍍機)		
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 1/4 頁		

一、目 的:

定義射頻濺鍍機操作規範,以確保操作品質。

二、範 圍:

適用於射頻濺鍍機。

三、權 責:

1. 組織權責:工程師負責制定及修改規範。

2. 執行人員資格:經過射頻濺鍍機考核通過之人員。

四、名詞定義:

無

- 五、 相關文件: 無。
- 六、 標準作業程序:
 - (一) MES 控制系統開啟設備

1.1 於 MES 控制系統輸入帳號密碼(User ID / Password)



1.2 開啟設備射頻濺鍍機

NARLab	≤ 國家實驗研究院	DOCUMENT NO. :	TITLE :			
台灣主	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	03 NI 04	設備作業標準			
	「寺腔町バール	Q3-INL04		(SE-011	射頻濺鍍機)	
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 2/4 頁	

(二) 開機

2.1 開啟總電源、觸控面板。

2.2 開啟冷卻水閥、製程 Gas 閥。



(三) 製程

AEX2: MOTOR 0 50 Pm Close
-3.6 mTerr 21 c 1.6 E -7 Torr 1.6 E -7 To
2.5E -2 Torr FV 32 A

3.1 開啟觸控面板,點選畫面選取,進入到操作畫面。

NARLah	s 國家實驗研究院	DOCUMENT NO. :	TITLE :			
台灣主	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	03 NI 04	設備作業標準			
	「等腔町バイル	Q3-INL04		(SE-011	射頻濺鍍機)	
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 3/4 頁	

Ar	02	N2	溫度	國力	関角	APC	RE1	No.74	17.00	_	
30						献力	NF1	山正軒等	時間		
						開け					
				5.0	0	周秋大山					
				5.0	0	属なり		50			
				5.0	0	(1 , 1 , 1)		50	10800		
				6.0	30	周秋月		50			
				6.0	30			50			
				6.0	30	秋 月1					
				6.0	30	11					
				6.0	30	8/1					
scem	seem s	cem		mT			W I	rpm	sec		

3.2 點取 WW 破真空, 直到 7.5 E+2 Torr 後, 才可開蓋將腔體打開。

3.3 試片放置完成後,將 O-ring 擦拭清潔後裝回,即可將上蓋放下關閉。

3.4 點取自動抽氣進行抽真空,等待真空度穩定至 5.0 E-6 Torr (背景壓力)

3.5 至製程參數設定,設定 Power 功率、Gas 流量,鍍膜時間,確認製程參數設定正 確常按載入參數即可。

3.6 跳回主畫面點取自動製程開始。

(四) 關機

4.1 製程完畢, Vent Chamber(確認 MV 關閉)

4.2 拿取試片,關閉腔體,抽真空至 5.0 E-6 Torr

4.3 關閉 Web 控制系統,填寫記錄本。

台灣半導體研究中心 Q3-NL04 設備作業標準 (SE-011 射頻濺鍍機) ISSUE DATE 2010 02 22 PEVISION 1.0 PACE 第 4/4 頁	NARLab	s 國家實驗研究院	DOCUMENT NO. :	TITLE :				
L) 与 I + I = U = U = U = U = U = U = U = U = U =	台灣主	4道體研究中心	Q3-NL04		設備作業標準			
ISSUE DATE 2010.02.22 DEVISION 1.0 DACE $\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4}$					(SE-011	射頻濺鍍機)		
ISSUE DATE 2019-02-22 REVISION 1.0 PAGE \$\$ 47.4 \colored \$	ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 4/4 頁		

- 七、應用表單及附件:
 - 1. Q4-NL02 設備管理卡
 - 2. Q4-NL03 設備考核表
 - 3. Q4-NL04 設備點檢表
 - 4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單